

L/S=5/5um 以下
SAP 用ドライフィルム・フォトレジスト
ALPHO NIT8025 / ALPHO NIT8125

ニッコー・マテリアルズ株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：楊 明雄)は、IC Substrate の微細回路形成用ドライフィルム・フォトレジスト ALPHO NIT8025 及び ALPHO NIT8125 のご紹介を 2019 年 6 月から開始いたします。

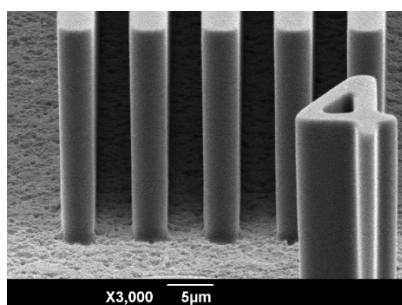
商品名 : ALPHO NIT8025, ALPHO NIT8125
適用プロセス : SAP (セミアディティブ・プロセス)
形成可能 L/S : 5/5um 以下

■開発の経緯

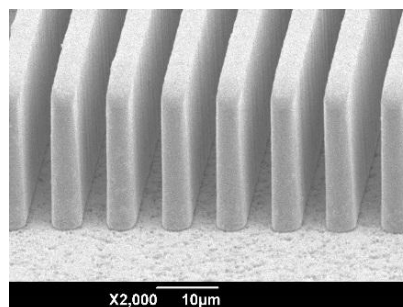
ニッコー・マテリアルズは、これまで SAP 用途の高解像・高密着性を有するドライフィルム・フォトレジストの販売・開発を行ってきました。FC BGA などの IC Substrate においては、今後、ますます基材の薄板化、低粗度化が進むと考えられます。基材が薄くなることにより、プロセス中の搬送ストレスなどの影響を受けやすくなり、低粗度化とあいまって微細回路を良好な歩留まりで形成することの難易度は高まるばかりです。

ニッコー・マテリアルズは、このような課題に対応すべく、高密着性を有すると同時に、搬送ストレスなどの影響を受けにくい高い柔軟性を有する ALPHO NIT8025、ALPHO NIT8125 を開発致しました。

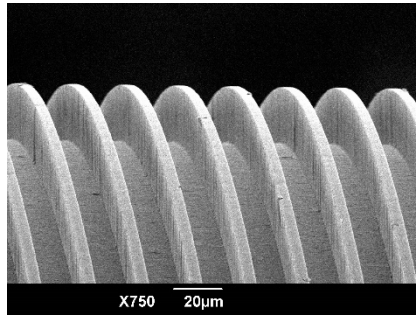
■特性紹介



ALPHO NIT8125
プロジェクション露光
現像後 L/S=4/4um
露光協力：ウシオ電機(株)



ALPHO NIT8125
プロジェクション露光
めっき後 L/S=4.5/4.5um



ALPHO NIT8025

プロジェクション露光

基材屈曲時の写真

L/S=4.5/18um

■今後の展開

2019 年 6 月から、開発品のご紹介と評価用サンプルの提供を開始致します。

■会社概要

商号 : ニッコー・マテリアルズ株式会社
代表者 : 代表取締役 楊 明雄
所在地 : 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 3-1 コンカード横浜 5F
設立 : 1997 年 9 月
事業内容 : ドライフィルム・フォトレジストおよびその関連製品、関連装置の製造・販売
資本金 : 4 億 600 万円
URL : <http://www.nikko-materials.com>

■本件に関するお問い合わせ先

担当者名 : 営業部 出口 嘉一
TEL : 045-620-9480
Email : kdeguchi@nikko-materials.com